

レーザー・光治療を
成功へ導くスキンケア
プラスリストア

plus
RESTORE®

デリケートな肌に しみない^{※1} 保湿剤

プラスリストア スキンモイスト W

レーザー・光治療後のバリア機能が 低下した肌のために開発した保湿剤です



スキンモイストW

50g <保湿乳液> ¥3,500 + 税

「バリア機能の強化による保湿」に着目し、ポリグルコサミン誘導体^{※2}を配合。低下したバリア機能をサポートし、うるおいが長時間続きます。徹底した低刺激設計で開発した保湿乳液です。

高保湿でもべたつかず、さらっとした使用感で、ボディにもおすすめです。

レーザー治療後は、表皮化した後からお使いいただけます。
(開放創にはお使いいただけません)

レーザー・光治療後のデリケートな時期に

乾燥性敏感肌の方に

化粧品がしみる方・時期に

使い方

適量を手に取り、肌にやさしくなじませてください。

◆顔以外にボディにもご使用いただけます



無香料・無着色・無鉱物油・パラベンフリー・アルコールフリー
パッチテスト・スティンギングテスト・ノンコメドジェニックテスト・アレルギーテスト済^{※1} pH値7.02

全成分:水、BG、グリセリン、パルミチン酸エチルヘキシル、ヘキサ(ヒドロキシステアリン酸/ステアリン酸/ロジン酸)ジペンタエリスリチル、ペンチレングリコール、リンゴ酸ジイソステアリル、水添パーム油、ステアリン酸ポリグリセリル-10、キトサンステアラミドヒドロキシプロピルスルホン酸Na、スクワラン、ホホバ種子油、マンダリンオレンジ果皮エキス、カルボマー、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、グルコシルセラミド、アミノ酸、アラントイン、グリチルリチン酸2K、α-グルカン、TEA、フェノキシエタノール

※1 全ての方にアレルギーやニキビ、皮膚刺激が起きないわけではありません。 ※2 キトサンステアラミドヒドロキシプロピルスルホン酸Na[特許第4394483号]:保湿剤

うるおいを与えるだけでなく 「バリア機能の強化による保湿」に着目

1 バリア機能の回復と創傷治癒をサポート

保湿にも様々なアプローチがある中『バリア機能の強化による保湿』に着目し、皮膚刺激が少なく皮膜形成効果や創傷治癒の促進といった魅力的な能力を持つ特許成分【両親媒性ポリグルコサミン誘導体*1】を配合した新しいタイプの保湿剤です。皮膚表面には、ポリグルコサミン誘導体*1のW効果により強固なバリア皮膜が形成され、低下した皮膚のバリア機能に対し補助的にはたらき、内部からの水分蒸発をおさえ、乾燥から守ります。

バリア皮膜
(イメージ)

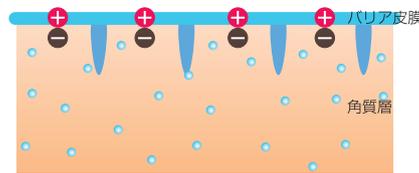
ポリグルコサミン誘導体*1がつくるバリア皮膜は、**アンカー効果**と**イオン吸着のW効果**により高い安定性を有し、**うるおいを長時間とどめます**。

アンカー効果

皮脂で覆われている親油的な角質表面に対し、疎水基(天然脂肪酸)がアンカーのように吸着

イオン吸着効果

マイナスに帯電している皮膚表面に対しプラスのポリグルコサミンがイオンのように吸着



参考文献：酒井康雄, 両親媒性天然多糖素材「ポリグルコサミン誘導体」の開発, FRAGRANCE JOURNAL 2013-12, p.57-66

2 刺激を最小限におさえる 3つの工夫

塗布時の刺激感をおさえるため pH 値を中性(7.02)に調整。

また、製造上配合が必要となる界面活性剤量を最小限に抑えるため、油分を水系に分散させることができる特殊な乳化法「D相乳化法」を採用しています。

治療後の敏感な肌にも使えるよう、刺激の少ない成分を厳選したフリー処方と、様々な角度から低刺激を追及しました。

刺激要因の排除

1. pH を中性に調整(pH7.02)
2. 界面活性剤を最小限に(D相乳化法)
3. 各種フリー処方

無香料・無着色・無鉱物油
パラベンフリー・アルコールフリー

各種テスト済み パッチテスト・スティンギングテスト・ノンコメドジェニックテスト・アレルギーテスト済み*2

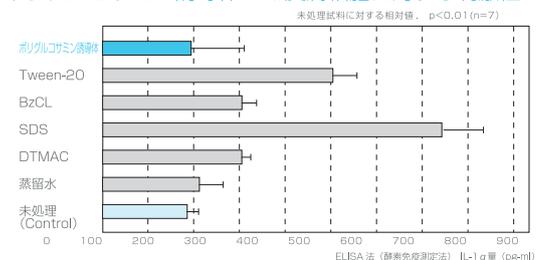
注目の保湿成分 ポリグルコサミン誘導体*1

ポリグルコサミンとは、保湿力に優れた成分で、しっかりと皮膚表面にとどまりバリア皮膜を形成、乾燥からお肌を守ります。

また、皮膚刺激が少なく、創傷治癒効果も高いことから人工皮膚などの医用材料にも活用されている注目の成分です。

このポリグルコサミンを化粧品に配合しやすくしたものが特許成分「ポリグルコサミン誘導体*1」です。

ポリグルコサミン誘導体*1の皮膚細胞に対する刺激性



Tween-20 (モノラウリン糖ポリオキシエチレンソルビタン) 5.0%：合成界面活性剤、化粧品の乳化剤など
BzCl (ベンゾイルクロリド) 0.5%：刺激性・毒性が強く各種細胞試験を行う際の陽性対照試料で用いられる
SDS (ラウリル硫酸ナトリウム) 0.4%：安価なシャンプー、歯磨き粉、洗剤などに含有
DTMAC (ドデシルトリメチルアンモニウムクロリド) 0.5%：リンスのベース剤、薬用石鹸の抗菌剤など

資料提供：天然新素材科学研究所株式会社

*1 キトサンステアラミドヒドロキシプロピルスルホン酸 Na[特許 第 4394483 号]：保湿剤 *2 全ての方にアレルギーやニキビ、皮膚刺激が起きないわけではありません。

株式会社ジェイメックは化粧品の売上の一部を、認定NPO法人「世界の子供にワクチンを日本委員会 (JCV)」に寄付しています。